3A06

SERS と IV の同時計測に基づく単分子接合の界面吸着構造の決定

(東工大・理) 金子哲, 0木口学

(Tokyo Institute of Technology) Satoshi Kaneko, Manabu Kiguchi

序: 対向した金属電極間に単分子を架橋させた単分子接合は、二つの金属一分子接 合界面を有する低次元ナノ構造体であり、孤立分子や結晶では観測されない特異的な 物性の発現が期待でき、注目を集めている。これまで様々な単分子接合が作製され、 最近では単分子ダイオード、スイッチ、メモリなどが報告されている[1,2]。一方、多 くの研究では、単分子接合の原子・電子構造を規定せず単に電気伝導度から議論され ることが多い。特に単分子接合では金属一分子接合界面の構造が、単分子接合の物性 に決定的な影響を与えるので、接合界面の構造の決定は重要である。そこで本研究で は、表面増強ラマン散乱(SERS)と電流一電圧特性(*I-V*)の同時計測により、単分子接合 の界面構造の決定法の開拓を行った[3]。単分子接合では分子が金属ナノギャップにト ラップされており、ギャップ間に形成される光増強場を利用した SERS 計測を行うの に最適な構造となっている。

実験: 単分子接合の SERS と *I-V* の同時計 測は図 1 に示すような自作の Mechanically controllable break junction(MCBJ)システムと 顕微ラマン分光システムを組み合わせた装 置で行った。ベンゼンジチオール(BDT)とア ミノベンゼンチオール(ABT)の 2 種類の単分 子接合について計測を行った。

結果: SERS は単分子接合形成時に著しく 増強され、単分子の SERS を計測しているこ



図1. (a)単分子接合のSERSと*I-V*の 同時計測システム.(b) 電極のSEM像 (c,d) 単分子接合のSERS と*I-V*の例

とが示された。観測された単分子接合の SERS を詳細に解析すると、接合ごとに振動 数が変化することが分かった。図 2 に、ABT 単分子接合における、ラマンシフトと *I-V* から決定した電気的な金属一分子カップリング強度の相関図を示す。振動数が小 さく、カップリングが大きい状態(状態1)と、振動数が大きく、カップリングの小 さな状態(状態2)が観測された。モデルクラスターを用いて、電気的なカップリン グと振動数を求め、実験結果と比較することで、状態1が bridge サイト、状態2が hollow サイトに帰属することができた。ここで強調したいのは、振動数およびカップ リング強度単体では分離出来なかった 2 つの吸着状態を、SERS と *I-V* の情報を組み 合わせることで、初めて分離出来たことである。 SERS と I-V の解析から、単分子接合における分子の吸着サイトを決定出来ること

が分かったので、本手法を吸 着サイトの時間変化の解析に 適用した。図3は、ABT単分 子接合における電気伝導度、 カップリング、振動数の時間 変化を2つのサンプルについ て示したものである。サンプ ルaではカップリング、振動数 共に bridge から hollow への変 化に対応した変化が観測され た。サンプル b ではカップリ

ングが bridge と hollow の境界領域 にあり吸着サイトを決定出来ない。 しかし振動数とカップリングの情 報を組み合わせることで、hollow か ら bridge に変化していることを明 らかに出来た。

以上、本研究では SERS と *I-V*の 同時計測を行い、金属-分子カップ リングと振動数の情報を組み合わ せることで、これまで不可能であっ た分子の吸着サイトを明確に識別 出来ることを示した。単分子接合に 限らず有機デバイスでは、金属と分 子の接合界面がデバイス特性に影 響を与える。今回開発した手法を有 機デバイスに適用することで、デバ イス特性の向上、革新的なデバイス 開発へとつながると期待出来る。



図 2. ABT 単分子接合におけるラマン振動数と金 属一分子カップリング強度の分布.



図 3. ABT 単分子接合における吸着サイト の時間変化.

参考文献

- 1. Y. Kato, Y. Tanaka, T. Tada, S. Fujii, M. Kiguchi, and M. Akita, J. Am. Chem. Soc., in press.
- S. Fujii, S. Marqués-González, J. Shin, H. Shinokubo, T. Masuda, T. Nishino, N. P. Arasu, H. Vázquez, M. Kiguchi, *Nat. Comm.* 8, 15984 (2017).
- 3. Y. Isshiki, S. Fujii, T. Nishino, M. Kiguchi, J. Am. Chem. Soc., 140, 3760-3767 (2018).